



ミニマルスパッタ成膜装置

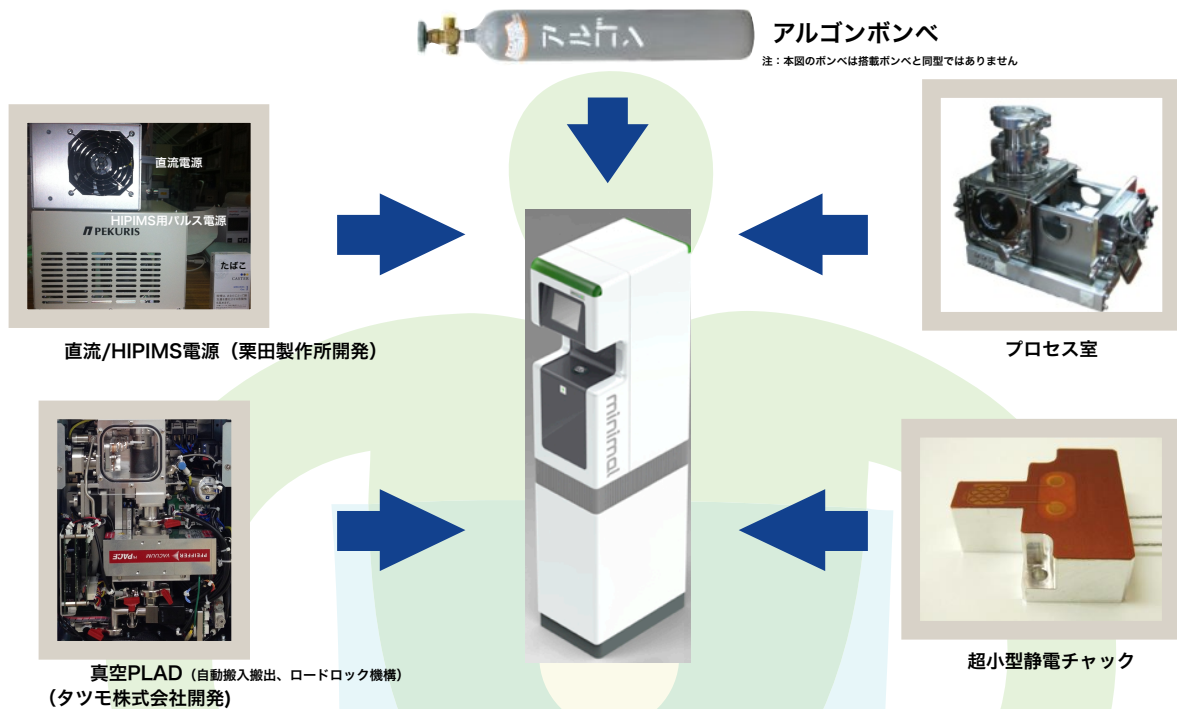
Sputtering Deposition Equipment for Minimal Fabs

誠南工業株式会社, 株式会社栗田製作所, (独)産業技術総合研究所



PVD everywhere !

ミニマルファブ共通筐体にオールインワン

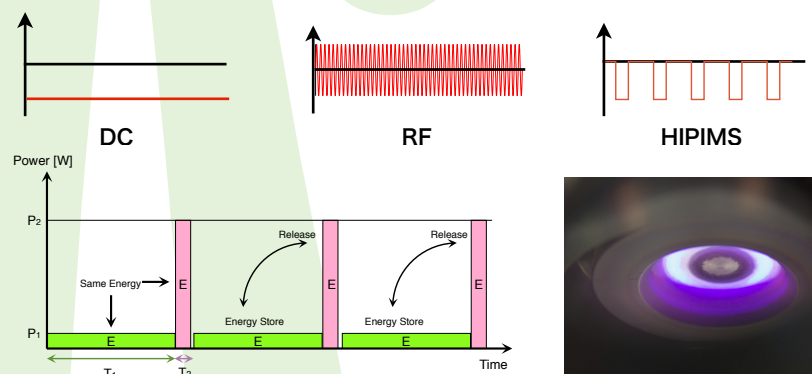


- 必要なユーティリティはAC100V, 圧縮空気, ベント用窒素だけ
- 真空PLAD搭載で、プロセス室は高真空をキープ
- ミニマルシャトルから搬入・プロセス・搬出の自動運転

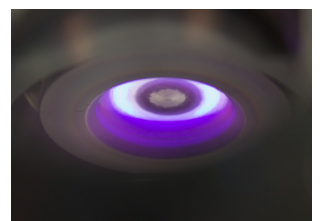


装置外観

世界最小のHIPIMS成膜装置 High Power Impulsed Magnetron Sputtering (HIPIMS)



パルスの駆動により高いピークパワーの実現と同時に
低い平均電力での動作が可能

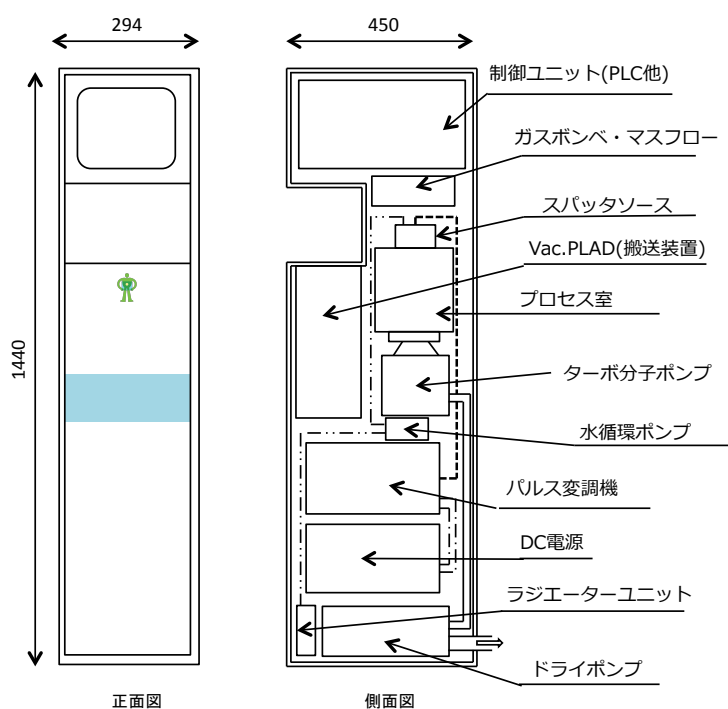


1インチマグネトロンスパッタ源

- 小型1インチマグネトロンスパッタ源を開発
- HIPIMS用小型電源搭載で、HIPIMS動作による高密度プラズマの発生が可能 (RFスパッタモードも開発中)

主な仕様

スパッタリング関係	
スパッタ源	1 インチマグネトロンスパッタ源
ターゲットサイズ	Φ32mm x 1t
スパッタ方式	HIPIMS, (電源切り換えでDCスパッタ可能) (RFスパッタも将来予定)
プロセスガス(Ar)流量	最大 20 sccm
対応試料	ミニマル規格ハーフィンチシリコンウェハー
試料ホルダー	小型静電チャック搭載
電源	
DC電源	最大電圧：～1000V, 最大電流：600 mA
HIPIMS用パルス変調器 (栗田製作所開発)	最大ピーク電流：50A, パルス幅：2～1200 μs, 最大繰り返し周波数：5000 Hz
真空系	
真空ポンプ	ターボ分子ポンプ + ドライポンプ
到達真空度	10 ⁻⁵ Pa 台 (ベーキング可能)
ロードロック	真空PLAD搭載
その他	
アルゴンボンベ	筐体内に内蔵 (外部ボンベからも導入可能)
必要ユーティリティ	AC100V, 圧縮空気, ベント用窒素ガス
サイズ	W294, H1440, D450 (ミニマル筐体)



予定発売元
誠南工業株式会社

開発元



<Access>

【所在地】

〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋4-3-24

【電話番号】 06-6682-6788

【ファックス】 06-6682-6750

【電子メール】 info@seinan-ind.co.jp

【ホームページ】 <http://www.seinan-ind.co.jp/>